日本国特許庁

PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2000年 4月19日

出 願 番 号 Application Number:

特願2000-117967

出 願 人 Applicant (s):

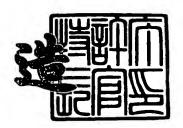
セイコーインスツルメンツ株式会社

2001年 4月13日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office







特2000-117967

【書類名】

特許願

【整理番号】

00000244

【提出日】

平成12年 4月19日

【あて先】

特許庁長官

殿

【国際特許分類】

G11B 7/135

【発明者】

【住所又は居所】

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 株式会社エスア

イアイ・アールディセンター内

【氏名】

光岡 靖幸

【発明者】

【住所又は居所】

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 株式会社エスア

イアイ・アールディセンター内

【氏名】

新輪 隆

【発明者】

《住所又は居所》 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 株式会社エスア

イアイ・アールディセンター内

【氏名】

加藤 健二

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 株式会社エスア

イアイ・アールディセンター内

【氏名】

大海 学

【発明者】

【住所又は居所】

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 株式会社エスア

イアイ・アールディセンター内

[氏名]

笠間 宣行

【発明者】

【住所又は居所】

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 株式会社エスア

イアイ・アールディセンター内

【氏名】

市原 進



【特許出願人】

【識別番号】 000002325

【氏名又は名称】 セイコーインスツルメンツ株式会社

【代表者】

服部 純一

【代理人】

【識別番号】

100096286

【弁理士】

【氏名又は名称】 林 敬之助

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008246

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9003012

【プルーフの要否】 不要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

光導波路プローブおよびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 走査型近視野顕微鏡に用いる光導波路プローブにおいて、

片持ちばり状の光導波路と、

前記光導波路先端に設けられ、前記光導波路に対して略垂直方向に先鋭化され た探針と、

前記探針の先端に設けられた微小開口と、

前記光導波路の先端近傍が前記探針側に折り曲げられた屈曲部とからなり、

前記屈曲部が前記光導波路内の伝搬光を偏向する偏向機能を有することを特徴 とする光導波路プローブ。

【請求項2】 前記屈曲部は、前記光導波路から前記微小開口までの光軸を含む光軸面に対して略対称な複数の面で折り曲げられていることを特徴とする請求項1記載の光導波路プローブ。

【請求項3】 前記複数の面は、複数の平面であることを特徴とする請求項 2記載の光導波路プローブ。

【請求項4】 複数の前記平面は、前記光軸面に対してそれぞれ垂直ではないことを特徴とする請求項3記載の光導波路プローブ。

【請求項5】 前記屈曲部での前記伝搬光の偏角が、90度より小さいことを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の光導波路プローブ。

【請求項6】 前記屈曲部は、反射膜を有していることを特徴とする請求項 1から5のいずれか一項に記載の光導波路プローブ。

【請求項7】 走査型近視野顕微鏡に用いる光導波路プローブの製造方法に おいて、

光導波路を堆積する基板を形成する基板形成工程と、

前記光導波路を前記基板上に堆積する堆積工程と、

前記光導波路の一部を前記基板から分離する分離工程を含み、

前記基板形成工程において、前記光導波路の一部を折り曲げるための屈曲状の 前記基板を形成することを特徴とする光導波路プローブの製造方法。 【請求項8】 前記基板形成工程は、

前記光導波路の光軸に平行な下面と、

前記下面に対して垂直ではなく、かつ前記光軸と前記下面の法線を含む面に対して略対称な複数の面と、を含む前記基板を形成する工程であることを特徴とする請求項7記載の光導波路プローブの製造方法。

【請求項9】 前記基板形成工程は、異方性エッチングを用いて形成する工程であることを特徴とする請求項7または請求項8記載の光導波路プローブの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

この発明は、近視野光を利用して試料の微細領域における光学特性を観察・計 測する光プローブであって、特に光導波路からなる光導波路プローブおよびその 製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

現在、走査型近視野顕微鏡(以下、SNOMと略す)では、先端が先鋭化された光媒体からなるプローブを、光の波長以下まで測定試料に近づけることで、試料の光学特性や形状を測定している。この装置の一つとして、試料に対して垂直に保持した直線状の光ファイバープローブの先端を、試料表面に対して水平に振動させ、試料表面とプローブ先端のせん断力によって生じる振動振幅の変化を、プローブ先端に照射したレーザ光の影の変化によって検出し、振幅が一定になるように試料を微動機構で動かすことによって、プローブ先端と試料表面の間隔を一定に保ち、微動機構に入力した信号強度から表面形状を検出するとともに試料の光透過性の測定を行う装置が提案されている。

[0003]

また、鈎状に成形した光ファイバープローブを原子間力顕微鏡(以下AFMと略す)のカンチレバーとして使用し、AFM動作すると同時に、光ファイバープローブの先端から試料にレーザ光を照射し、表面形状を検出するとともに試料の

光学特性の測定を行う走査型近視野原子間力顕微鏡が提案されている(平7-174542)。この光ファイバープローブは、光媒体に光ファイバーが用いられ、光ファイバーの周囲は金属膜被覆で覆われている。また、探針部が先鋭化されており、探針部の先端に開口を有する。

[0004]

さらに、光導波路をコアとクラッドの積層からなるカンチレバー状に構成し、 一端には先鋭化された探針部、他端には光導波路を固定する支持部が形成されて おり、探針部側の光導波路は湾曲した構造を持つ光導波路プローブも知られてい る。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、SNOMで使用する光ファイバープローブは、光ファイバーを 材料として多くの工程を手作業で製造しており、量産性が低く、探針部の先端径 や先端角、開口径などの形状が不均一であるという問題点があった。また、プロ ーブ走査を高速かつ損傷なく行うためには、プローブの共振周波数を高く、かつ バネ定数を小さくする必要がある。しかし、光ファイバーを光媒体として使用し ているので、小型化して高共振周波数、低バネ定数にすることが難しいといった 問題点があった。

[0006]

さらに、光ファイバーや光導波路を湾曲させたプローブでは、湾曲している部分で伝搬光の損失が生じ、伝搬光を効率よく伝搬することができないと言う課題があった。

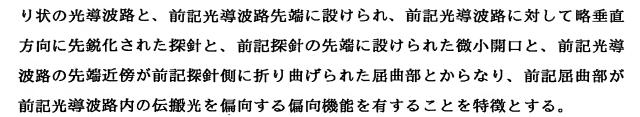
[0007]

本発明は上記に鑑みてなされたものであって、量産性、均一性、高速走査性に優れ、効率よく伝搬光を伝搬させることのできる光導波路プローブ、およびその 光導波路プローブを作製する製造方法を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するために、本発明にかかる光導波路プローブは、片持ちば



[0009]

また、前記屈曲部は、前記光導波路から前記微小開口までの光軸を含む光軸面に対して略対称な複数の面で折り曲げられていることを特徴とする。

[0010]

また、前記複数の面は、複数の平面であることを特徴とする。

[0011]

また、複数の前記平面は、前記光軸面に対してそれぞれ垂直ではないことを特 徴とする。

[0012]

また、前記屈曲部での前記伝搬光の偏角が、90度より小さいことを特徴とする。

[0013]

また、前記屈曲部は、反射膜を有していることを特徴とする。

[0014]

上記光導波路プローブによれば、屈曲部において効率よく伝搬光を偏向することができるので、微小開口から光を出射する効率、あるいは微小開口で光を検出する効率を向上することができる。さらに、光導波路を伝搬してきた伝搬光を微小開口へ集光したり、その逆に、微小開口からの光をコリメートすることができるため、効率を向上することができる。

[0015]

上記の目的を達成するために、本発明にかかる光導波路プローブの製造方法は、光導波路を堆積する基板を形成する基板形成工程と、前記光導波路を前記基板上に堆積する堆積工程と、前記光導波路の一部を前記基板から分離する分離工程を含み、前記基板形成工程において、前記光導波路の一部を折り曲げるための屈曲状の前記基板を形成することを特徴とする。

[0016]

また、前記基板形成工程は、前記光導波路の光軸に平行な下面と、前記下面に対して垂直ではなく、かつ前記光軸と前記下面の法線を含む面に対して略対称な複数の面と、を含む前記基板を形成する工程であることを特徴とする。

[0017]

また、前記基板形成工程は、異方性エッチングを用いて形成する工程であることを特徴とする。

[0018]

上記光導波路プローブの製造方法によれば、型となる基板上に光導波路を積層して作製することができるため、量産性、形状再現性、均一性が向上する。また、小型の光導波路プローブを作製することができるため、低バネ定数で高共振周波数を有する光導波路プローブを作製することができる。そのため、プローブを損傷なく高速走査することが可能となる。また、伝搬光を効率よく伝搬することのできる屈曲部を形成することが可能となる。

[0019]

【発明の実施の形態】

以下、この発明につき図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。

(実施の形態1)

図1は、この発明の実施の形態1を示す光導波路プローブの構成を示す構成図である。図1(a)は上面図、図1(b)はAA、断面での断面図、図1(c)はDD、断面での断面図、図1(d)は光伝搬の様子を示す拡大模式図である。光導波路プローブ50は、光導波路2と、それを支える支持部1とから構成されている。光導波路2は、支持部1に積層され、一体に形成されている。光導波路2は、片持ちばり状の弾性機能部3とその先端の探針部9を有し、先端近傍には探針部9側に折り曲げられた屈曲部10が形成されている。探針部9は先鋭化されており、その先端に微小開口5を有する。光導波路2は、略中心部に光を伝搬するコア4とその外周部のクラッド6とから構成されている。図示していないが、弾性機能部3や探針部9は遮光膜で覆われ、探針部9先端の遮光膜で覆われて

いない部分が微小開口5となる。

[0020]

クラッド 6 の屈折率は、コア4 の屈折率に比べて相対的に小さい。弾性機能部 3 の長さは、例えば 50μ mから 1000μ mである。探針部 90 の長さは、例えば 1μ mから 30μ mである。コア4 の光軸に垂直な断面形状は四角形であり、一辺長は 1μ mから 100μ mである。光導波路 20 の光軸に垂直な断面形状は略四角形であり、一辺長は 5μ mから 500μ mである。支持部 100μ である。支持部 100μ である。支持部 100μ である。支持部 100μ である。支持部 100μ である。支持部 100μ である。大導波路 100μ である。大導波路 100μ である。大導波路 100μ である。大導波路 100μ である。大導部 100μ である。大導部 100μ である。大導部 100μ である。大導部 100μ である。大導波路 100μ である。大導波路 100μ である。大導波路 100μ の 100μ の

[0021]

光導波路2は、弾性機能部3の先に探針部9が形成され、弾性機能部3の途中が探針部9側に折り曲げられている。本実施の形態では、図1(d)に示すように、2平面12、13が交差する屈曲部10によって光導波路2が折り曲げられ、2平面12、13の交線に沿ってコア4を形成する。この2平面12、13は、図1(c)に示すように、光導波路2を形成している基板1の面に対しては約55度傾くとともに、光導波路2の光軸と微小開口5を含む面(AA)断面)に対して対称で、90度に交差している。

[0022]

入射端11からの入射光8は、光導波路2に入射後、コア4内を伝搬する。伝搬してきた伝搬光7は屈曲部10で反射して、微小開口5へ導入される。コア4とクラッド6との屈折率差が十分大きく、その界面で伝搬光7が全反射されるのが望ましい。全反射しない場合には、クラッド6表面に反射膜を形成しても良い。このような構造においては、伝搬光7が偏向される偏角が小さく(例えば90

度以下)、屈曲部10を形成する2平面12、13に対して伝搬光7が入射する角を小さくできるため、コア4とクラッド6の界面で全反射が起こりやすく、屈曲部10での損失を低減できる。また、伝搬光7を光軸方向にそのまま反射させるのではなく、微小開口5側へ集光させるように反射させることが可能であり、コア4内の伝搬光7を微小開口5近傍に集光することができる。これらのことから、屈曲部10においては、コア4内の伝搬光7が効率よく、集光されて微小開口5に反射されるので、微小開口5から強度の強い近視野光を出射することができる。

[0023]

微小開口5で検出し、光導波路2内を逆方向に光が伝搬する場合においても同様に、効率よく光を反射することができる。ここでは、2平面12、13によって屈曲部10を形成する場合を例にとり説明したが、それぞれが曲面であっても良いし、2面ではなく4面やそれ以上の面から構成しても良い。

[0024]

また、光導波路2の先端方向に光検出器を配置し、反射モードで試料の光学特性を観察する場合には、微小開口5がカンチレバー状の光導波路2先端に形成されているため、試料での反射光が光導波路2で遮られる部分が少なく、効率よく試料での反射光を検出することができる。

[0025]

以上説明したように、上記光導波路プローブ50によれば、 光導波路2の入射端11から入射光8を導入し、微小開口5から測定試料に対して光を照射することができる。または、試料表面に局在する光を微小開口5で検出し、光導波路2の入射端(この場合は出射端になる)11後方に配置する検出器で検出することもできる。これら微小開口による光照射や光検出を効率よく行うことができる

[0026]

また、弾性機能部3は小型化可能で、バネ定数および共振周波数は弾性機能部3の長さや幅によって調整することができる。よって、弾性機能部3は、低バネ定数、高共振周波数とすることができるため、試料やプローブを損傷することな

く高速に走査することができる。

(実施の形態2)

図2は、実施の形態1の光導波路プローブ50の製造方法を示す説明図である。図3、図4はそれぞれ図2(b)、(e)での上面図である。図2(a)は、基板31上にマスクとなる二酸化珪素32をパターニングした状態を示す。基板31はシリコンからなるが、型が形成できれば、石英基板等でも良い。図2(b)は、パターニングした二酸化珪素32をマスクとして、水酸化カリウム(KOH)やテトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド(TMAH)を用いた異方性エッチングにより、光導波路の屈曲部となる型を形成する工程を示す。この型の上面図が図3である。BB、断面で示すように(CC、断面も同じ)、基板31の下面37に対して、角度(約55度)を有する斜面36を2面形成する。この2面は90度で交差している。

[0027]

図2(c)は、屈曲型上に光導波路33を堆積する工程を表わしたものである。屈曲型上に、クラッド材を堆積し、その上にパターニングしたコア材を堆積し、さらにその上にクラッド材を堆積する。 コア材およびクラッド材の堆積方法は、材料によって適した方法が用いられる。例えば酸化珪素の場合、気相合成法(以下、CVDと略す)、スパッタ、真空蒸着などを用いる。クラッド材の屈折率はコア材の屈折率よりも相対的に小さい。

[0028]

図2(d)は、堆積した光導波路33上に、探針部を有する片持ちばり状にパターニングするためのマスク34を形成する工程を示す。図2(e)は、マスク34を用いて光導波路33をパターニングする工程を示す。ドライエッチングやウェットエッチングにより光導波路33をパターニングすることが可能である。この状態の上面図を図4に示す。下面37、斜面36に沿って探針部を有する光導波路35を形成している。探針部は基板31に対して略垂直方向に先鋭化されている。

[0029]

図2(f)は、光導波路35の一部を基板31から分離する工程を示している

。光導波路35を支持する基板を残して、基板31をエッチングで除去することにより、片持ちばり状の光導波路プローブ50を形成する。

[0030]

さらに図示しないが、片持ちばり状の光導波路35の周囲に金属(A1やCrなど)を蒸着やスパッタにより成膜し、探針部先端に微小開口を形成する。

[0031]

以上説明した工程によれば、実施の形態1の光導波路プローブ50を容易に、 量産性、均一性良く製造することが可能である。

[0032]

【発明の効果】

以上説明したように、本発明にかかる光導波路プローブによれば、従来のSNOMの光ファイバープローブに比べて小型で、低バネ定数、高共振周波数にすることができるため、試料やプローブに損傷を与えることなく、高速に走査することができる。

[0033]

また、屈曲部において効率よく伝搬光を反射させることができるため、微小開口から近視野光を出射する場合でも、微小開口で光を検出する場合でも、光を効率よく導波路内を伝搬させることができる。

[0034]

また、本発明にかかる光導波路プローブの作製方法によれば、容易に、量産性、再現性、均一性良く作製することができ、低価格で本光導波路プローブを提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

この発明の実施の形態1にかかる光導波路プローブの構成を示す構成図である

【図2】

この発明の実施の形態2にかかる光導波路プローブの製造方法を示す説明図である。

【図3】

この発明の実施の形態2にかかる光導波路プローブの製造工程における説明図である。

【図4】

この発明の実施の形態2にかかる光導波路プローブの製造工程における説明図である。

【符号の説明】

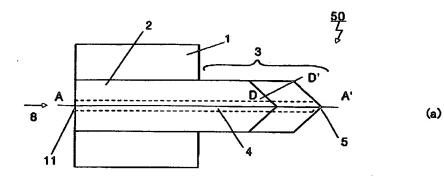
- 1 支持部
- 2 光導波路
- 3 弹性機能部
- 4 コア
- 5 微小開口
- 6 クラッド
- 7 伝搬光
- 8 入射光
- 9 探針部
- 10 屈曲部
- 11 入射端
- 12、13 平面
- 3 1 基板
- 32 二酸化珪素
- 33 光導波路
- 34 マスク
- 35 光導波路
- 36 斜面
- 37 下面
- 50 光導波路プローブ

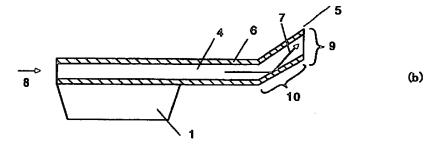


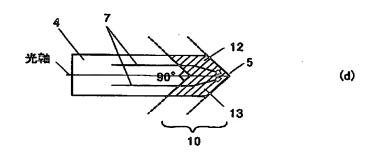
【書類名】

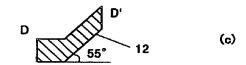
図面

[図1]



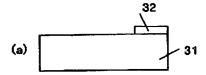


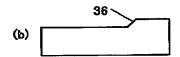


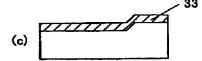


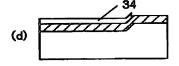


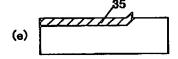
[図2]

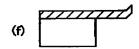




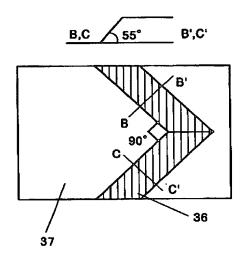




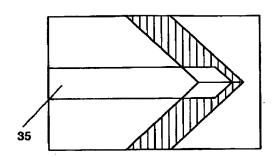




[図3]



【図4】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 走査型近視野顕微鏡に用いられ、光伝搬損失が少なく、AFM動作可能な光導波路プローブ、およびその製造方法を得ること。

【解決手段】 光導波路2の光軸を含む面に対称な複数の面により、光導波路2の先端近傍が探針部9側に屈曲している。これにより、屈曲部10での伝搬光7の損失を低減できると共に、微小開口5へ伝搬光7を集光できるため、微小開口5から効率よく近視野光を出射することができる。

【選択図】 図1

特2000-117967

出願人履歴情報

識別番号

[000002325]

1. 変更年月日 1997年 7月23日

[変更理由] 名称変更

住 所 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 氏 名 セイコーインスツルメンツ株式会社